This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

ffenlegungsschrift

[®] DE 42 43 040 A 1



DEUTSCHES PATENTAMT

21) Aktenzeichen:22) Anmeldetag:

Anmeldetag: 18. 12. 92
 Offenlegungstag: 24. 6. 93

(5) Int. Cl.⁵:

H 05 K 1/05

C 03 C 10/00 H 01 L 23/08 H 01 L 23/373

③ Unionspriorität: ② ③ ④

18.12.91 US 809371

18.12.91 US 809372

7 Anmelder:
General Electric Co., Schenectady, N.Y., US

(4) Vertreter:

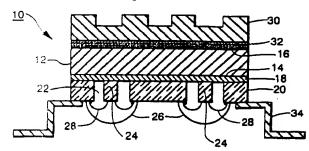
von Bezold, D., Dr.rer.nat.; Schütz, P., Dipl.-Ing.; Heusler, W., Dipl.-Ing., Pat.-Anwälte, 8000 München 2 Erfinder:

P 42 43 040.2

Cherukuri, Satyam Choudary, Cranbury, N.J., US; Onyshkevych, Lubomyr Stephen, Lawrenceville, N.J., US; Prabu, Ashok Narayan, East Windsor, N.J., US; Thaler, Barry Jay, Lawrenceville, N.J., US

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Mehrschichtige Metall-Keramik-Schaltungsplatte und Verfahren zu ihrer Herstellung
- Die Erfindung betrifft generell beliebige Typen von als Ganzes gebrannten, mehrschichtigen Keramik-auf-Metall-Schaltungsplatten als neuer Gegenstand sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung. Sie betrifft insbesondere verschiedene Materialien eines MgO-B₂O₃-SiO₂-Glas-Keramik-Systems und Materialien aus einer solchen Glaskeramik und geeigneten Füllstoffen, die sich für die Herstellung von als Ganzes gebrannten, mehrschichtigen Keramik-auf-Metall-Schaltungsplatten eignen, bei denen die zusammengebrannte mehrschichtige Keramik wünschenswerte elektrische Eigenschaften und einen Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweist, der weitgehend mit dem der gleichzeitig erhitzten Metallbasis übereinstimmt, wenn diese Materialien auch anderweitig verwendet werden können. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen solcher Schaltungsplatten (10) unter Verwendung einer Bindeschicht (18) aus Glas, die einen Wärmeexpansionskoeffizienten hat, der nicht größer als der der Metallbasis (2) ist. Die Glas-Bindeschicht hat einen Erweichungspunkt unter dem des Glases in der auf ihr angeordneten mehrschichtigen Keramik (20), so daß das Glas der Bindeschicht beim Brennen der Glas-Keramik fließt, sich mit dem Metall verbindet und gleichzeitig die laterale Schrumpfung der mehrschichtigen Keramik minimal



DE 42 43 040 A1



Die vorliegende Erfindung betrifft eine mehrschichtige, gemeinsam gebrannte Keramik-auf-Metall-Schaltungsplatte gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Es ist bekannt, mehrschichtige, gemeinsam gebrannte Keramik-Schaltungsplatten aus einem Stapel von Schichten aus im Handel erhältlichem keramischem dielektrischen Bandmaterial herzustellen, wie es unter dem Handelsnamen GREEN TAPE von der Firma E.I. Du Pont Company. Wilmington, Delaware, USA erhältlich ist. Die Schichten aus dem keramischen Bandmaterial haben jeweils eine Dicke von etwa 0,13 mm. Die Oberfläche jeder Schicht kann mit metallischen Leitern bedruckt sein, die miteinander durch kleine Löcher (im englischen Sprachgebrauch "vias") in einer oder mehreren dieser Schichten elektrisch verbunden werden können. Die Löcher werden mit einem leitfähigen Material ausgefüllt. Eine solche durch einen gemeinsamen Brennvorgang hergestellte keramische Schaltungsplatte ist beispielsweise in der US-PS 50 41 695 (J. A. Olenick) beschrieben.

Es stehen zwei Typen von miteinander, gemeinsam gebrannten keramischen Schaltungsplatten zur Verfügung, nämlich:

1) bei hoher Temperatur (typischerweise unter 1300°C) gebrannte und

15

2) bei niedriger Temperatur (typischerweise unter 1000°C) gebrannte.

Die Hochtemperatur-Cobrenn-Technologie wird für Aluminiumoxid- und Aluminiumnitrid-Keramik verwendet, während die Niedertemperatur-Cobrenn-Technologie für Glaskeramik (mit keramischem Füllstoff beschwerte Gläser im Glaszustand oder entglasten Zustand) verwendet wird. Die Leitermetallurgie für bei hoher Temperatur gleichzeitig gebrannte Schaltungsplatten arbeitet mit Woder Mo-Mn, während bei Schaltungsplatten, die als Ganzes bei niedriger Temperatur gebrannt werden, Leiter aus Ag, Au, AgPd oder Cu verwendet werden.

Ein Problem, das bei der Herstellung von mehrschichtigen, als Ganzes gebrannten keramischen Schaltungsplatten auftritt, ist der Volumenschwund beim Brennen. Dieser Schwund, der sowohl in den Flächenrichtungen x und y als auch in der Dickenrichtung z der jeweiligen Schichten auftritt, hat seine Ursache darin, daß während des Brennens Luft entweicht, welche zwischen den Teilchen sowie im organischen Binder des grünen Bandmaterials eingeschlossen ist. Der Schwund ist verhältnismäßig groß, typischerweise 10 bis 15% für bei niedriger Temperatur als Ganzes gebrannte Mehrschicht-Schaltungsplatten. Man kann zwar versuchen, den Schwund in den Flächenrichtungen x und y durch Überdimensionierung der Fläche der Schichten aus dem grünen Bandmaterial zu kompensieren, es ist jedoch recht schwierig, den Schwund konsistent zu kontrollieren. Um beispielsweise die Schwankungen der x- und y-Abmessungen einer gebrannten mehrschichtigen Schaltungsplatte innerhalb eines Toleranzbereiches von 0,1% zu halten, ist ein Grad von Kontrolle erforderlich, der bis zu ein oder zwei Teile pro hundert im Ausmaß des Schwundes betragen kann. Aus diesem Grund ist der Ausschuß bei als Ganzes gebrannten Schaltungsplatten hoch. Die bei niedriger Temperatur als Ganzes gebrannten mehrschichtigen Schaltungsplatten haben außerdem wegen der Glaskeramik eine schlechte Wärmeleitfähigkeit und eine niedrige Biegefestigkeit.

Es sind auch Einfachschichten aus Keramik bekannt, die auf ein Metallsubstrat aufgebrannt sind, wie Porzellanemail auf Stahl. Da der Wärmeausdehnungskoeffizient des das Substrat biidenden Stahls relativ groß ist, muß auch das Material der auf das Stahlsubstrat aufgeschmolzenen Keramikschicht einen relativ großen Wärmeausdehnungskoeffizienten haben, um dem des Substrats möglichst nahe zu kommen. Man hat Glaskeramiken mit hohem Bariumgehalt und hohem Ausdehnungskoeffizienten entwickelt, die für die Herstellung solcher Porzellanemail-auf-Stahl-Platten verwendet werden können. Es sind auch andere Keramiksysteme bekannt, die einen relativ großen Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweisen, der hohe Wärmeausdehnungskoeffizient dieser Systeme wird typischerweise durch den Zusatz von Oxiden von Schwermetallen, wie Blei, Barium oder Alkalien, z. B. Natrium und Kalium, erreicht. Dies hat jedoch höhere Dielektrizitätskonstanten und höhere dielektrische Verluste zur Folge und kann zu einer schlechteren chemischen Beständigkelt führen, was solche Systeme hoher Wärmedehnung zu schlechten Kandidaten für die Verwendung zur Herstellung von mehrschichtigen, als ganzes gebrannten Keramik-Schaltungsplatten macht, die in mikroelektronischen Baugruppen oder Moduleinheiten und zur Halterung und zum Anschluß von IC-Chips verwendet werden können.

Durch die vorliegende Erfindung soll, allgemein gesprochen, eine mehrschichtige, als Ganzes gebrannte Keramik auf einer Metallbasis, insbesondere ein System von für ein Brennen als Ganzes geeigneten Niedertemperatur-Glaskeramiken mit hohem Ausdehnungskoeffizienten geschaffen wurden, welches bei Feinabstimmung mit gewissen Füllmaterialien Dielektrizitätskonstanten und dielektrische Verluste aufweist, die genügend niedrig sind, um sie für die Herstellung von mehrschichtigen, als Ganzes gehrannten, Keramik-auf-Metall-Schaltungsplatten für mikroelektronische Baugruppen geeignet zu machen, auch die Erfindung soll ferner ein Verfahren zum Herstellen solcher Schaltungsplatten angegeben werden, ein der eine sichere Verbindung der Keramik mit der Metallbasis (Metallsubstrat) gewährleistet ist.

Die Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer mikroelektronischen Baugruppe, die gemäß der Erfindung hergestellt wurde, und

Fig. 2 ein Flußdiagramm der Verfahrensschritte einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

Zur Herstellung der in Fig. 1 im Schnitt und stark vergrößert dargestellt. E. Struktur stellt man als erstes eine Metallbasis oder ein Metallsubstrat 12 mit zwei einander entgegengest den Hauptflächen 14 und 16 her, beispielsweise durch Stanzen eines nicht dargestellten Metallkernes und Auschließendes Anlassen des Kernes bei einer Temperatur von etwa 500 bis 900°C um eine gute Dimensionsstabilität zu gewährleisten. Die Oberflä-

DE **42** 43 **0**40

chen des Kerns werden gereinigt, um Schmutz und Oxide zu entfernen. Vorzugsweise wird mindestens eine der Hauptslächen 14 und 16 mit einem geeigneten Material, wie Kupser, mit einer Dicke von etwa 0,5 bis 25 µm galvanisiert. Geeignete Materialien für das Substrat 12 sind u. a. Cu. Al, Ni, nichtrostender Stahl, kohlenstoffarmer Stahl, Cu/Invarstahl/Cu, Cu/Mo/Cu oder Cu/nichtrostender Stahl/Cu, wobei letzteres bevorzugt wird.

Eine Bindeschicht 18 aus Glas, insbesondere eines Glases mit einem Wärmeexpansionskoeffizienten, der kleiner ist als der des Substrats 12, wird als Suspension auf eine der Hauptflächen, z. B. die Fläche 14 des Substrats 12 aufgebracht. Die Suspension kann durch Siebdruck, Sprühen, Schleuderbeschichtung, Streichen, Fluidbettbeschichtung, elektrophoretisches Niederschlagen oder andere äquivalente Methoden erfolgen. In der Praxis wurden bei der Herstellung von Schaltungsplatten gemäß der Erfindung Siebdruck- und Sprühverfahren verwendet. Auf der Glas-Bindeschicht 18 wird eine mehrschichtige Keramikstruktur 20 vorgesehen.

Die mehrschichtige Keramikstruktur 20 kann durch Aufbringen von mehreren Schichten grünen Bandes auf die Glas-Bindeschicht hergestellt werden oder die laminierte Keramikstruktur kann biskuitgebrannt oder getrocknet werden, bevor sie auf die Glas-Bindeschicht 18 aufgebracht wird. Für eine Cu/nichtrostender Stahl/Cu-Basis wird die resultierende Struktur in Stickstoff (etwa 10 000 ppm O2) mit einer Spitzentemperatur von etwa 900 bis 930°C für etwa 2 bis 20 Minuten als Ganzes gebrannt, um die Keramik mit der Oberfläche 14 der Basis oder des Substrats 12 zu verbinden. Die Binde-Zwischenschicht 18 aus Glas hat zwei Funktionen: Sie dient zur Anbringung der mehrschichtigen Keramik 20 an der Basis 12 und sie hält den Schwund der Keramik 20 in der xund der y-Dimension während des Brennens minimal. Die Bindeschicht 18 aus Glas muß außer, daß sie einen Expansionskoeffizienten, der kleiner als der der Metallbasis 12 ist, hat, genügend mit der Kupferbeschichtung und den Kupferoxiden auf der Oberfläche 14 der Basis 12 reagieren, um die Verbindung zwischen der Keramik 20 und der Basis während des gemeinsamen Brennvorganges zu fördern und aufrechtzuerhalten. Das Glas der Bindeschicht 18 muß einen relativ niedrigen Erweichungspunkt (kleiner als 600°C) haben, so daß es fließen und sich mit der Oberfläche 14 der Metallbasis 12 verbinden kann, und es muß geeignete Oberflächenspannungseigenschaften bei Temperaturen unterhalb des Erweichungspunktes des Glases in der Keramikschicht 20 aufweisen, um den lateralen (x und y) Schwund der Keramik so klein wie möglich zu halten. Außerdem muß das Glas der Bindeschicht 18 eine gute chemische Beständigkeit und gute dielektrische Eigenschaften aufweisen.

Die Zusammensetzung der Glas-Bindeschicht 18 wird durch die Zusammensetzung des Metallkernes und seiner thermischen Eigenschaften sowie durch die Zusammensetzung des Keramiklaminats, die Sintereigenschaften und das bei der Herstellung der zusammengebrannten Keramik-auf-Metall-Schaltungsplatte verwendete Verfahren beeinflußt. Jede Schicht der mehrschichtigen Keramikstruktur enthält eine Glaskeramik/Füllstoff-Zusammensetzung mit einem Wärmeausdehnungskoeffizient, der nur dem der Basis und der Glas-Bindeschicht im Temperaturbereich von Raumtemperatur bis etwa 600°C weitgehend übereinstimmt. Eine Anzahl von Gläsern des Mehrstoffsystems PbO-ZnO-BaO-B2O3-SiO2 sind für die bi deschicht 18 geeignet. Diese Gläser können auch kleine Mengen von ZrO2 und Al2O3 enthalten. Einige verall emeinerte Zusammensetzungen und ihre typischen Eigenschaften sind in der folgenden Tabelle I aufgeführt.

Tabelle I

Glas-System	Wärmeausdehnur: s- koeffizien: (10 ⁻⁷)/*℃	Einweichungs- punkt (°C)	40
Pb-Borat	75 —120	280—430	
Pb-Zn-Borat	70-110	320-450	45
Pb-Borosilicat	4 0 —120	370—700	43
Pb-Zn-Borosilicat	7 5— 80	370-700	
Pb-Zn-Ba-Borosilicat	75—100	380-400	
Pb-Aluminosilicat	60 85	440-485	
Pb-Alumino-Borosilicat	80 — 90	390-440	50

Keramik-auf-Metall-Schaltungsplatten gemäß der Erfindung wurden unter Verwendung von Gläsern der Pb-Zn-Borosilicat- und Pb-Zn-Ba-Borosilicat-Glassysteme, die in Tabelle I aufgeführt sind, hergestellt. Das bevorzugte Glas des Pb-Zn-Ba-Borosilicat-Systems ist ein handelsübliches Glas mit der Bezeichnung SCC-11. das von der Firma SEM-CON Co. Toledeo, OH, USA erhältlich ist. Ein anderes geeignetes Glas aus demselben System wird von der Firma Owens Illinois, Toledo, OH, USA, unter der Bildeichnung CV-808 vertrieben. Dieses letzterwähnte Glas enthält einen kleinen Anteil an ZrO2. Ein geeignetes Guss aus dem Pb-Zn-Borosilicat-System ist das Glas des Typs CV-101 der Firma Owens Illinois.

Diese Bindegläser wurden mit Erfolg eingesetzt, um eine gute Haften i der laminierten Keramik an einer Cu/nichtrostender/Stahl/Cu-Basis 12 zu gewährleisten. Außerdem wird der x-y-Schwund der laminierten Keramikschicht 20 durch Verwendung dieser Gläser um mehr als eine Größer. Anung auf etwa 0,8% verringert. Der x-y-Schwund des Keramiklaminats beträgt ohne die Glas-Bindeschicht 16 sypischerweise 12-15%. Die Metallbasis 12 weist außerdem eine gute thermische Leitsähigkeit und eine hoh. Biegesestigkeit auf, so daß auch die Probleme der schlechten Wärmeleitfähigkeit und niedrigen Biegefestigket. Der bekannten Schaltungsplatten, die nur eine mehrschichtige, bei niedriger Temperatur als Ganzes gebrann: Glaskeramik enthalten, überwunden

35

Für die Leitermetallurgie eignen sich Ag, Au, AuPt, AgPd, Ni und Ca. Wonn Schaltungsplatten mit Edelmetal-

leitern als Ganzes gebrannt werden, können Stickstoff oder irgendeine andere inerte Atmosphäre erforderlich sein, um eine Oxidation der Metallbasis zu verhindern. In dem laminierten Band können geeignete Schlitze für integrierte-Schaltungs-Chips vorgesehen sein, um diese direkt auf der Metallbasis anzuordnen, wobei ein Kleber, ein Lot oder irgendein anderes direktes Verbindungsverfahren verwendet werden kann, um eine sehr wirksame Hitzeverteilung zu gewährleisten. Eine Schaltung hoher Dichte kann auf der als Ganzes gebrannten Keramik unter Verwendung der Photolithographie für die Deckschichtleiter hergestellt werden. Es ist außerdem möglich, zusätzliche Polymerschichten auf die als Ganzes gebrannte Keramik, z. B. durch Schleuderbeschichtung, aufzubringen und dann Dünnschicht-Galvanisierungs- oder Schichtbildungstechniken zur Bildung von Schaltungen sehr hoher Dichte zu verwenden.

Die hier beschriebene Technologie für die als Ganzes gebrannten Schaltungsplatten auf Metallbasis ermöglicht es außer der Herstellung von Schaltungsplatten hoher Dichte mit ausgezeichneten Wärmeableitungs- bzw. Wärmeverteilungs- und Schwundsteuereigenschaften auch eine mechanisch robuste Basis zu erhalten. Ferner können IC-Schaltungsplättchen und andere Komponenten direkt am Metall angebracht werden, indem man Schlitze entweder im grünen Bandmaterial vorsieht, wie es in Fig. 1 dargestellt und unten beschrieben ist oder auf der der mehrschichten Keramik entgegengesetzten Seite der Metallbasis. Die Komponenten können durch Löten, Drahtverbindung, TAB (Filmbonden) Flip-Chip- oder Klebstoff-Befestigung angebracht werden. Die Kapselung kann hermetisch (Glas-Metall-Verschmelzung) oder nichthermetisch mit geeignetem Einhüllen oder Vergießen zum Komponentenschutz erfolgen.

Es ist nicht beabsichtigt, die erfindungsgemäße, mit Brennen als Ganzes arbeitende Mehrschicht-Keramikauf-Metall-Technologie der vorliegenden Erfindung auf irgendeine spezielle Anwendung zu beschränken, sie eignet sich jedoch besonders für mikroelektronische Packungen und Einheiten, da die gebrannte mehrschichtige Keramik hierfür geeignete elektrische Eigenschaften und andere günstige Eigenschaften aufweist. Diesbezüglich wird auf die folgende Tabelle II verwiesen, die ein Beispiel für eine Pflichtenliste der elektrischen und anderen Eigenschaften enthält, bei einem praktischen Fall einer mikroele stronischen Packung von der gebrannten mehrschichtigen Keramik gefordert werden.

Tabelle II

	Eigenschaften	Jewünschter Wert
30		
	Wärmeexpansionskoeffizient (25 − 250° C)	$90-130\times10^{-7}$ /°C
35	Dielektrizitätskonstante (1 MHz)	< 6,6
	Verlustfaktor (1 MHz)	< 0,0035
	Spannungsfestigkeit	> 2 kV/mm
	Spezifischer (Volumen-)Widerstand	> 10 ¹² Ohm cm
	Flächenwiderstand der vergrabenen Leiter	< 10 mOhm/Quadrat
	Spezifischer Widerstand von Via-Leiter	:50 mOhm/Quadrat
40	Spezifischer Widerstand der Oberflächenleiter	< 50 mOhm/Quadrat
	Krümmung	< 0,005"/Zoll
	Langzeit-Zuverlässigkeit (HHBT-Bedingungen)	(keine Kurzschlüsse)

In der Tabelle II beziehen sich die HHBT-Bedingungen bezüglich der Langzeit-Zuverlässigkeit auf einen beschleunigten Alterungstest, bei welchem eine Mikroelektronikpackungsprobe bei hoher Feuchtigkeit und hoher Temperatur eine vorgegebenen Spannungsbeanspruchung für eine bestimmte Zeit ohne elektrischen Durchbruch standhalten muß.

Die Verwendung der mit Brennen als Ganzes arbeitenden Mehr Schicht-Keramik-auf-Metall-Technologie der vorliegenden Erfindung auf mikroelektronische Packungen und Einneiten erforderte die Entwicklung von Glaskeramik- (GC)-Materialien, die in Glaskeramik + Füllstoff (GC/F)-Z isammensetzungen verwendet werden können, die den in Tabelle II aufgeführten Anforderungen genügen.

In der Vergangenheit wurden Glas-, Glaskeramik- und Glas + Füll-Stoff-Systeme entwickelt und mit Erfolg in mikroelektronischen Packungen für Anwendungen mit hoher Packungsdichte verwendet. Der hauptsächliche Vorteil dieser Materialien über die konventionellen Keramiken, wie Alt Liniumoxid, ist die niedrigere Brenntemperatur, die die Verwendung von Materialien mit hoher elektricher haltfähigkeit, wie Ag, Cu, Au und Ag-Pd als verträgliche Metallisierungen ermöglicht. Während dieser Entwicklengen entstand eine Vielzahl von Glas-Keramik- und Glas + Füllstoff-Systemen, man hat jedoch in erster Linie auf die Anpassung der Wärmedehnung an Silizium und in manchen Fällen an Ga-As Wert gelegt. Die Wärmeen: ansionskoeffizienten reichen typischerweise von 30 - 70 × 10⁷/° C. Die Fragen der Beherrschung der Dielektrizt itskonstante, der dielektrischen Verluste, der Festigkeit, der spezifischen Masse- und Oberflächenwiderstand i, der elektrischen Durchbruchsfestigkeit, der chemischen Beständigkeit, des Schwundes während des Brechens und der Verträglichkeit mit der Metallisierung wurden in einem großen Bereich von Borat-, Borc silicat- and Silicat-Glas- sowie Glas-Keramik-Systemen, die Füllstoffe mit niedriger oder mittlerer Wärmeexpamsion et ...elten, wie Aluminiumoxid, Cordierit, Forsterit, Eucryptit usw. angesprochen. Keines dieser Glas-, Glas-, corann.k- und Glas + Füllstoff-Systeme erfüllt jedoch einigermaßen die Anforderungen hinsichtlich der in der Tabelle ist aufgeführten Werte. Insbesondere ist der Expansionskoeffizient dieser bekannten Systeme zu niedrig, um sig zicht Erfolg bei der Herstellung als Ganzes gebrannten hochdichten Mehrschicht-Keramik-auf-Metall-Schaltungsp. - te averwenden zu können.

Es ist eines der Ziele der vorliegenden Erfindung

DE 42 43 040 A1

1) ein Glas-Keramik-System und spezielle Glas-Keramik-Materialien innerhalb dieses Systems mit geeigneten thermischen, elektrischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften anzugeben, die sie zu möglichen Kandidaten für die Verwendung zur Herstellung von als Ganzes gebrannten hochdichten Mehrschicht-Keramik-auf-Metall-Schaltungsplatten machen und

2) dann geeignete Füllstoffe in solche Prospektiven GC-Kandidaten zu inkorporieren, um die GC/F-Materialien so fein abzustimmen, daß ihre Eigenschaften den in Tabelle II geforderten Werten im wesentlichen genügen.

In der folgenden Tabelle III ist ein MgO-B₂O₃-SiO₂-System angegeben, welches CaO, ZnO und SnO₂ als Zusätze enthält und das für die Entwicklung von prospektiven Glas-Keramik-(GC)-Kandidaten für die Verwendung bei der Herstellung einer als Ganzes gebrannten hochdichten Mehrschicht-Keramik-auf-Metall-Schaltungsplatte gewählt wurde. Den Gläsern wurden keine Alkalioxide absichtlich zugesetzt, sie können jedoch als Verunreinigungen in den Rohmaterialien vorhanden sein. ZrO₂ wurde in allen Materialien als Keimbildungsmittel zur Steuerung der Kristallisation zugesetzt. Die Zusammensetzung der verschiedenen Gläser, die hergestellt und untersucht wurden, sind in der Tabelle III aufgeführt. Gl. s-Keramik wurde durch Wärmebehandlung der Gläser bei 850-950°C für 10-30 Minuten erzeugt. Der Wärmeexpansionskoeffizient der resultierenden Glas-Keramiken reichte von 85 bis 105×10⁻⁷/°C über einen Temperaturbereich von Raumtemperatur (RmT) bis etwa 600°C (wie die unten in Tabelle III aufgeführten thermischen Expansionskoeffizienten der Glas-Keramiken GC-1 bis GC-7 im speziellen zeigen), was für ein weiteres Maßschneidern durch Einbringung von Füllstoffen geeignet ist. Die Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit wurde dadurch bes hent, daß die Glas-Keramiken Dampf von 1,05×10⁵ Pa (15psi) für zwölf Stunden ausgesetzt wurden. Keines der Materialien zeigte eine sichtbare Verschlechterung durch die Feuchtigkeit.

Tabelle III

Prospektive Glas-Keramik-Zusammensetzungen im 1/20 – B2O2 – SiO2-System (Gewichts-%)

25

50

Nr.	α×10 ⁻	a×10 ⁻⁷ /°C								
	SiO₂	B ₂ O ₃	MgO	ZnO	CaO	nO₂		ZrO ₂	Cr ₂ O ₃	RmT-600°C
GC-1	17	28	45	8,5	_	-		1,5		92
GC-2	17,8	31,0	48,6	_	_			2,6		97
GC-3	16,4	28,5	43,2	9,5	_	_		2,4		105
GC-4	17,5	29,5	43	_	4			2,0		86
GC-5	14,5	25,2	34,7	5,6	4,8	3,0		2,1		84
GC-6	14,3	24,8	34,2	_	6,7	i 7, 9		2,1		86
GC-7	16,9	30,0	39,1	9,1	3,7	-		1,2		85
GC-8	15,9	28,3	41,2	9,23	4.2	· -		1,2		_
GC-9	17,5	31,8	43,0	_	6,53	-		1,2		_
GC-10	16,7	30,4	29,9	_	21,9			1,1		_
GC-11	16,1	28,5	25,1	8,7	20,5			1,1		_
GC-12	16,8	29,8	38,8	9,1	3,6	-		0,9	1,0	_
GC-13	15,8	28,0	34,4	8,5	3,4		6.4	0,4	1,5	_
GC-14	16,6	30,0	31,8	8,4	3,4		٠,	0,4	1,5	_

Basierend auf den Zusammensetzungen der Glas-Keramik, n GC-1 bi: GC-14 wurden die folgenden Zusammensetzungsbereiche (in Gewichts-%) als geeignet für expantionsangepaßte Glas-Keramiken, die gemeinsam auf Cu/rostfreier Stahl/Cu-Metallkerne oder -Substrate gebrannt werden, festgestellt:

SiO ₂	10-20%
B_2O_3	20-35%
MgO	25 — 50%
ZnO	0-10%
CaO	0-22%
SnO ₂	0-18%
BaO	0-10%

Es kann möglich und zweckmäßig sein, andere Oxide einschließlich All all- und Schwermetalloxide in kleinen Mengen mit kleinerem Einfluß auf die Dielektrizitätskonstar e und die Allektrischen Verluste hinzuzufügen. Anstelle von ZrO2 können auch andere Keimbildungsmittel, wie TiO2 und auch andere Keimbildungsmittel, wie TiO2 und aungsmittel eingesetzt werden. Beispielsweise können bis zu 5 Gew.-% (einzeln oder in Kombination) dieser Keimbildungsmittel eingesetzt werden. Um eine gewünschte Farbe zu erhalten, können bis zu 3 Gew.-% (einzeln oder in Kombination) von Cr2O3, CoO, Fe2O3, CuO, CeO2, und/oder Pr2O3 eingesetzt werden. Die Glas-Kernmillann ferner als weitere Zusätze bis zu 10 Gew.-% (einzeln oder in Kombination) Li2O, Na2O, K2O, AllO3, PbO, in O3 und/oder SrO enthalten.

Drei Füllstoffe wurden als Kandidaten zur Feinabstimmung der Eigenschaften der Glaskeramik ausgewählt,

5

nämlich Flußspat (CaF2), Quarz (SiO2) und Cristobalit (SiO2). Die thermischen Expansionskoeffizienten von Flußspat, Quarz und Cristobalit im Bereich von 20 bis 600°C sind 225, 237 bzw. 271 x 10⁻⁷/°C. Es wurden verschiedene Glas-Keramik/Füllstoff-(GC/F)-Kombinationen mit üblichen Bandgießverfahren verarbeitet. Einer oder mehrere dieser Füllstoffe, bis zu 50 Vol.-%, wurden für die Änderung der Expansion und der Dielektrizitätskonstante der Basis-Glas-Keramik (GC) in Betracht gezogen. Durch Änderung des Füllstoffanteils im Glas-Keramik/Füllstoff-System kann der Expansionskoeffizient der Glas-Keramik/Füllstoff-Systeme bis auf 130×10^{-7} C erhöht werden.

Fünf neue Glas-Keramik/Füllstoffmaterialien GC/F-1 bis GC/F-5 mit Eigenschaften, die sie für die Verwendung bei der Herstellung als Ganzes zum Verbinden der Strektur und zum Sintern der Keramik fertiggebrannten mehrschichtigen Keramik-Schaltungsplatten geeignet mit den, sind unten in Tabelle IV aufgeführt. Es wurde gefunden, daß von diesen fünf Glas-Keramik/Füllstoffmaterlahen die Typen GC/F-4 und GC/F-5 insgesamt die besten Eigenschaften für den vorliegenden Zweck haben.

Tabelle IV

	GC/F-1	GC/F-2	GC/F-3
Zusammensetzung (Gew%)	70 GC-7 + 15 Flußspat + 15 Quarz	75 GC-8 ÷ 25 Flußspat	70 GC-9 + 15 Quarz + 15 Flußspat
Expansionskoeffizient (10 ^{–7} /°C) (RmT-600°C)	116	106	110
Dielektrizitäts-Konstante (bei 10 kHz)	6,4	5 ,6	6,5
Verlust-Faktor (bei 10 kHz)	0,2%	0.2%	0,2%
	GC/F-4		GC/F-5
Zusammensetzung	70 GC -	· •	70 GC-13
(Gew%)	+ 15 F ⁻ + 15 C ⁻		+ 15 Flußspat + 15 Quarz
Expansionskoeffizient (10 ⁻⁷ /°C) (RmT600°C)	115—		120-125
Dielektrizitäts-Konstante (bei 1 MHz) Verlust-Faktor	6,2-6,1		6,3-6,9
(bei 10 kHz) (bei 1 MHz)	0,1% 0.3%		0,3%
Max. Brenn-Temp. (°C)	930—§		0,5% 910—9 20
Feuchtigkeits-Beständigkeit HHBT (60° C, 90% rF, 48 V)	gut bestai.		gut bestanden
Spez. Volumen-Widerstand	> 1012	m · cm	> 10 ¹² Ohm •

Zur weiteren Erhöhung des Wärmeexpansionskoeffizienten und zur Verbesserung des Schwundverhaltens können insgesamt bis zu 50 Gew.-% der Füllstoffe Quarz. Flu. pat und Cristobalit einzeln oder in Kombination verwendet werden.

Ein Beispiel einer mikroelektronischen Packung oder Eint. Die als Ganzes gebrannte Keramik-auf-Metall-Struktur 10 et zweite Hauptfläche 14 bzw. 16 aufweist, und die gemeinsam ersten Hauptfläche 14 durch die Glas-Bindeschicht 18 verbu. Füllstoff-Bandes kann vor dem Brennen mit geeigneten Löch in oder Vias versehen werden, welche nach dem Brennen Schlitze 22 in der gemeinsam gebrannten mehrse, ichtigen Keramik 20 bilden, so daß integrierte Schaltungschips 24 (oder andere Komponenten) unmittelbar Ein Gehäuse 26, das die jeweiligen Chips 24 abdeckt, kann ner Die Chips 24 werden elektrisch, z. B. durch Drahtverbinden o sen. Alternativ können die Chips 24 jeweils durch eine nich. geschützt werden.

An der entgegengesetzten Hauptfläche 16 der Basis 12 i. bracht. Die mikroelektronische Einheit enthält ferner eine in. in einem nicht dargestellten Gerät montiert werden kann.

Obwohl in Fig. 1 nicht dargestellt, enthält die gemeinsam Leiter, die derzeit Ag und Ag/Pd enthalten. Metallische Leiter,

sines Mehrchip-Moduls ist in Fig. 1 dargestellt. at dir Metallbasis 12, welche eine erste und eine raniite mehrschichtige Keramik 20, die mit der a ist. jede Lage des laminierten Glas-Keramik/ s der Metallbasis 12 angebracht werden können. Lisch mit der Metallbasis 12 verbunden werden. andere bekannte Mittel elektrisch angeschloswith the Vergußmasse oder Verkapselung 26

inen Kleber 32 ein Kühlkörper 30 angearungestruktur 34, mit der das Multichip-Modul

and mehrschichtige Keramik 20 metallische u Gar Au enthalten, sollten jedoch ebenfalls

mit den gemeinsam gebrannten mehrschichtigen Keramik-auf-Metall-Platten des hier beschriebenen Typs verträglich sein.

Die neuen Glas-Keramik-(GC)-Materialien, die in Tabelle Glas-Keramik/Füllstoff-Materialien, die in Tabelle IV aufgeführt eind, wurden zwar für die Verwendung in einer mikroelektronischen Packung oder Halterungsstruktur eine Fig. 1 dargestellten Typs entwickelt, diese neuen Materialien : schicht-Keramik-Packungen oder Halterungsstrukturen mit e

Bei dem in Fig. 2 dargestellten neuen Verfahren wird eine Com-Bindeschicht 18 beispielsweise durch Sprühbeschichtung auf die eine Hauptsläche, z. B. die Fläche 14, Ausführungsform des Verfahrens wurde eine Schicht aus eine Suspension hergestellt worden war, indem man es in Pulve. geeigneten Lösungsmittels, wie 2-Propanol, Aceton. Ethanol zugt wird. Die laminierte Keramik-Schicht 20 kann getrennt Lagen aus selektiv metallisiertem Glas-Keramik/Fülistoff-Ban. aufeinanderstapelt und die laminierte Struktur einer Vorerhi... organischen Bestandteile aus ihr zu entfernen und einen mo-Keramik- Schicht 20 kann alternativ dadurch gebildet werder mitgestanzten Durchbrüchen versehenen Glas-Keramik/Füll Bei dem bevorzugten Verfahren wird die Glas-Bindeschicht : das Glas der Bindeschicht vorher fließen zu lassen und eine 0,025 mm auf der Oberfläche 14 zu bilden. Dann wird die vor. chicht 18 gelegt und die ganze Struktur wird zusammen, als etwa 2-20 Minuten bei bei einer Temperatur von 900-930 Brenntemperaturen beim gemeinsamen Endbrand hängen vo. der Keramik-Schicht 20 ab. Die Haftung der mehrlugigen Verwendung der Glas-Bindeschicht 18 resultiert, verringert gemeinsamen Brennens ganz erheblich und der Volumensch oder Dickenrichtung beschränkt.

aufgeführt sind und insbesondere auch die leramik-auf-Metall-Multichip-Moduls des in . jedoch sicher auch für andere übliche Mehrohne Metallbasis oder Metallsubstrat brauch-

Basis 12 aufgebracht. Bei einer bevorzugten Has des Typs SCC-11 verwendet, von dem eine mit etwa 60 bis 90 Volumen-Prozent eines Terpinol mischte, wobei 2-Propanol bevorestellt werden, indem man eine Anzahl von dem Durchbrüche oder Vias gebildet wurden, g oder einem Biskuitbrand unterwirft, um die ithischen Keramik-Körper zu erzeugen. Die a man mehrere Lagen aus metallisiertem und pand auf die Glas-Bindeschicht 18 aufbringt. eine Temperatur von etwa 450°C erhitzt, um nen Glasüberzug mit einer Dicke von etwa bildete Keramikschicht auf die Glas-Bindess in Stickstoff (ungefähr 10 000 ppm O2) für ertiggebrannt oder gesintert. Die maximalen etall der Basis 12 und der Zusammensetzung mikschicht 20 an der Basis 12, die aus der y-Schwund der Keramikschicht während des der Keramik wird in erster Linie auf die z-

Patentanspru.

1. Als Ganzes gebrannte mehrschichtige Keramik-auf-Me Metall-Basis (12), eine Bindeschicht (18) aus Glas auf die mehreren Schichten eines Keramikbandes auf der Binde: ren Keramikbandschichten ein Glas-Keramik/Fillistoff-M 2. Schaltungsplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeit stoff-Material Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweis peratur bis etwa 600°C weitgehend übereinstimmen.

3. Schaltungsplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzei. folgenden Eigenschaften hat:

einen Wärmeausdehnungskoeffizienten im Bereich von a eine Dielektrizitätskonstante unter 6,9 bei 1 MHz und einen Verlustfaktor von höchstens 0,5% bei 1 MHz.

4. Schaltungsplatte nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch geramik/Füllstoff-Materials eine ausgewählte Glas Keran stem ist.

5. Schaltungsplatte nach einem der vorhergehenden Ans ramik/Füllstoff-Material aus mindestens 50 Gew. 16 😅 Füllstoff-Material besteht und daß das Füllstoff-Materia enthält.

6. Schaltungsplatte nach einem der vorhergehenden Anaus einem der folgenden Materialien besteht: Cu, Al, i Cu/Invar/Cu, Cu/Mo/Cu und Cu/rostfreier Stahl/Cu.

7. Schaltungsplatte nach einem der vorhergehenden An eine der Schichten der gemeinsamen gebrannten mehrs Leiter aus mindestens einem der Leitermaterialien Ag. 4

8. Schaltungsplatte nach einem der vorhergehenden A. schichtige Keramik (20) mindestens einen Schlitz (22) at durchgeht.

9. Schaltungsplatte nach Anspruch 8 gekennzeichnet dur in den Schlitz (22) reicht und direkt an dem darunter liege: 10. Schaltungsplatte nach Anspruch 9, dadurch gekenn? (24) ein integrierte-Schaltung-Plättchen enthält.

11. Schaltungsplatte nach Anspruch 9 oder 10. geker mikroelektronische Komponente (24) und den Schittz (20) angebracht ist.

12. Schaltungsplatte nach Anspruch 11, dadurch gekennze

schaltungsplatte, gekennzeichnet durch eine sasis, und eine Keramikstruktur (20), die aus it gebildet ist, wobei jede Schicht der mehreal enthält.

. daß das Metall und das Glas-Keramik/Füllin einem Temperaturbereich von Raumtem-

laß das Glas-Keramik/Füllstoff-Material die J×10⁻⁷/°**C**;

ceichner, daß die Glas-Keramik des Glas-Kes einem MgO-B2O3-SiO2-Glas-Keramik-Sy-

. dadurch gekennzeichnet, daß das Glas-Keramik-Material und höchstens 50 Gew.-% rz und/oder Flußspat und/oder Cristobalit

he, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall ostender Stahl, Ni, kohlenstoffarmer Stahl,

e, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens igen Keramik (20) aufgedruckte elektrische . Ag/P Ni und Cu enthält.

ie, dac irch gekennzeichnet, daß die mehri, der i i zu dem Metall unter dem Schlitz

ie mikroelektronische Komponente (24), die Metall as gebracht ist.

et, daß die mikroelektronische Komponente

net dur h eine Verkapselung (26), die die deckt dan der mehrschichtigen Keramik

et, daß die mikroelektronische Komponente

30

(24) durch die abdeckende Verkapselung (26) hermetisch 13. Material, welches eine ausgewählte Glas-Keram enthält, die sich für die Verwendung bei der Herstell keramischen Schaltungsplatte eignet, dadurch gekenn: peraturbereich von Raumtemperatur bis etwa 600° C el $85 - 105 \times 10^{-7}$ C aufweist. 14. Material nach Anspruch 13 gekennzeichnet durch el

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

65

expansionskoeffizienten, um den Wärmeexpansionskoe. im Bereich von 85-105 x 10⁻⁷/°C der ausgewählten C 90 - 130 × 10⁻⁷/°C im Bereich von Raumtemperatur bi. 15. Verfahren zum Herstellen einer als Ganzes gebran mehrschichtige Keramik-Anordnung auf einer Metallt aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß

eine Bindeschicht (18) aus Glas auf eine (14) der Haupt... welche Glas-Bindeschicht einen Wärmeexpansionskoeff die mehrschichtige Keramik (20) auf der Glas-Bindeschi ... die Basis, die Bindeschicht aus Glas und die mehrschiel. g die ausreicht, um die Keramik sicher an der Basis anzub. 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich mehrschichtige Keramik (20) auf ihr angeordnet wird, a das Glas der Bindeschicht vorher fließen zu lassen.

17. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeiche 900°C bis 930°C durchgeführt wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, de Stickstoffatmosphäre durchgeführt wird.

Hierzu 2 Seite(n) 2

eschlossen ist.

einem MgO-B2O3-SiO2-Glaskeramik-System ner als Ganzes gebrannten, mehrschichtigen t, daß die Glas-Keramik selbst in einem Tem-/ärmeexpansionskoeffizienten im Bereich von

üllstoff mit einem ausreichend hohen Wärmeiten des Materials von dem betreffenden Wert Ceramik selbst auf einen Wert im Bereich von 600°C zu erhöhen.

Ceramik-f-Metall-Schaltungsplatte, die eine thält, welche entgegengesetzte Hauptflächen

(14, 16) der Metallbasis (12) aufgebracht wird. hat, der nicht größer als der der Basis ist. .) angeoranet wird und

Ceramik auf eine Temperatur erhitzt werden,

aB die F ieschicht (18) aus Glas, bevor die Temper r von etwa 450°C erhitzt wird, um

die Erhirung bei einer Temperatur von etwa

gekenne ichnet, daß die Erhitzung in einer

ngen

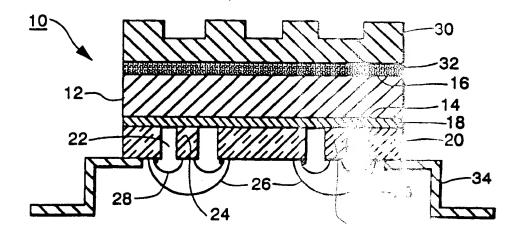


Fig. 1

